

2021年3月期（2020年4月～2021年3月） 業績予想に関する説明会

2020年6月18日

内容：

- 事業環境と業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

**新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い影響を受けられた
すべての方々に謹んでお見舞い申し上げます。**

**また、このような困難な状況のなか、一日も早く日々の
生活を取り戻すためにご尽力いただいている、医療関係者
をはじめすべての方々に心よりお礼申し上げます。**

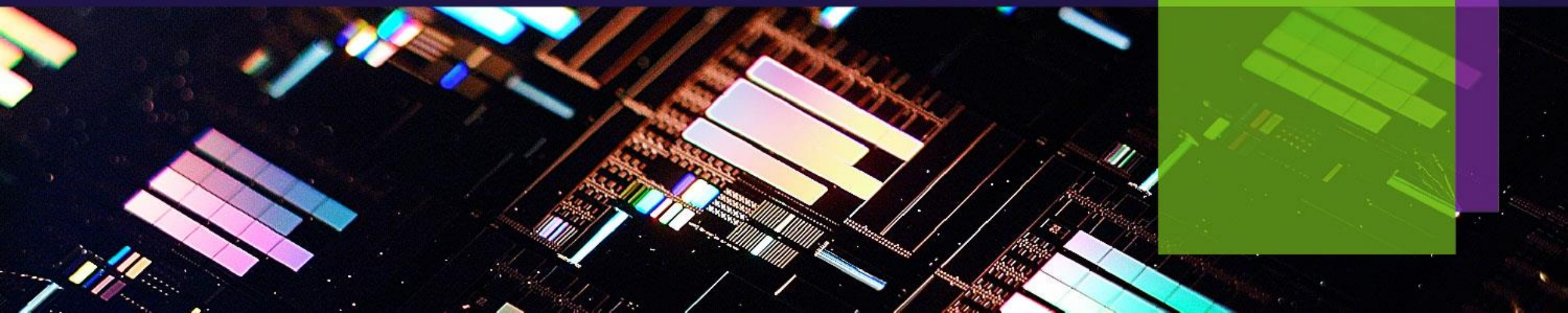
代表取締役社長・CEO



事業環境と業績予想

2020年6月18日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2020年6月時点での見方）

- ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資
CY2020の投資は、前年比10%程度の増加を想定
マクロ経済の動向に注視は必要だが、足元の引き合いは堅調
過去最高のWFE市場規模になると予測
- ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資
TV向け大型パネル投資は継続。モバイル向けOLED投資が回復
CY2020は前年比15%程度の成長を期待

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2020 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年と同程度の高い水準を見込む
 - 市場環境：先端世代、成熟世代とも需要は堅調
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比15～20%程度増加
 - 市場環境：設備投資の約8割が1Ynm以降世代向け
 - 事業機会：微細化に対応した新たな技術の採用
- 不揮発性メモリ：前年比50%程度増加
 - 市場環境：生産能力の増強投資が加速
9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

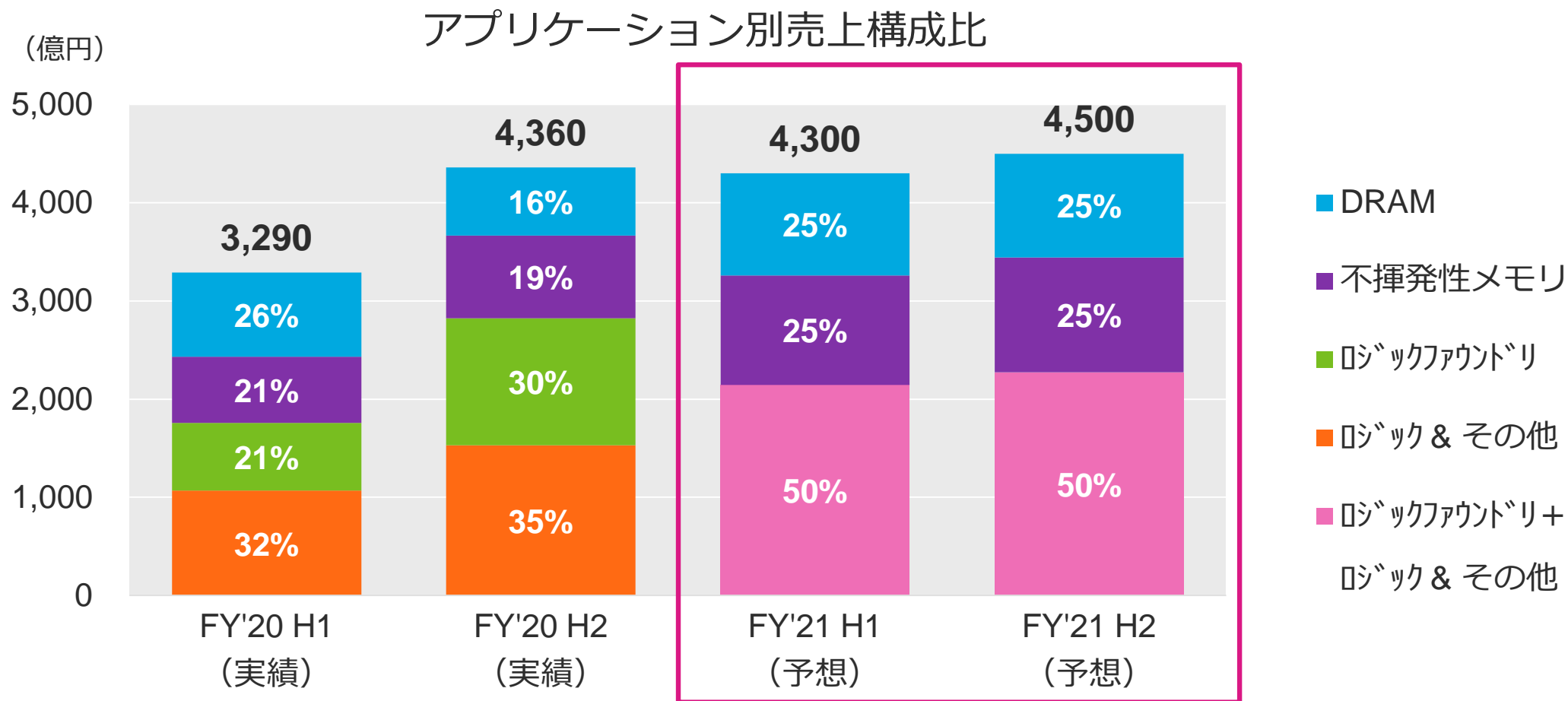
FY2021 業績予想

(億円)

	FY2020 (実績)	FY2021 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	11,272	6,200	6,600	12,800	+13.5%
SPE	10,609	5,850	6,150	12,000	+13.1%
FPD	660	350	450	800	+21.0%
売上総利益	4,519	2,480	2,720	5,200	+679
下段：売上総利益率	40.1%	40.0%	41.2%	40.6%	+0.5pts
販管費	2,146	1,210	1,240	2,450	+303
営業利益	2,372	1,270	1,480	2,750	+376
下段：営業利益率	21.0%	20.5%	22.4%	21.5%	+0.5pts
税金等調整前当期純利益	2,446	1,270	1,480	2,750	+303
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,852	950	1,100	2,050	+197
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	610.83	-	1,318.11	+147.54

成長投資を継続しつつ、売上高と利益の増加を目指す

FY2021 SPE部門 新規装置売上予想

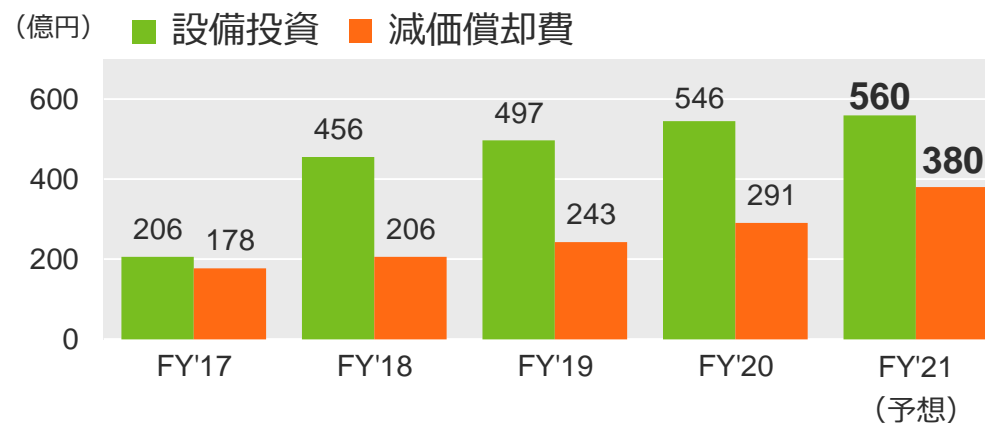
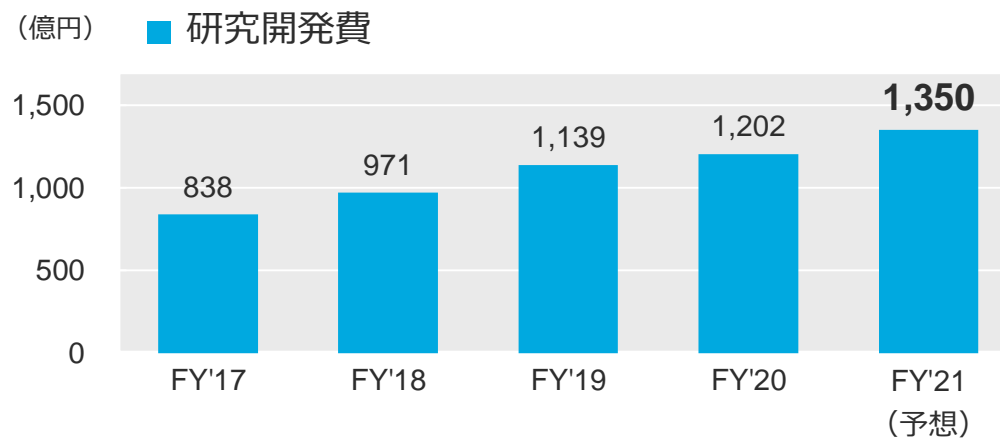


メモリ向け投資の回復に伴い売上は増加

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。FY2021の構成比予想は概算値です。

FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,350億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 380億円



新生産棟の建設

(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



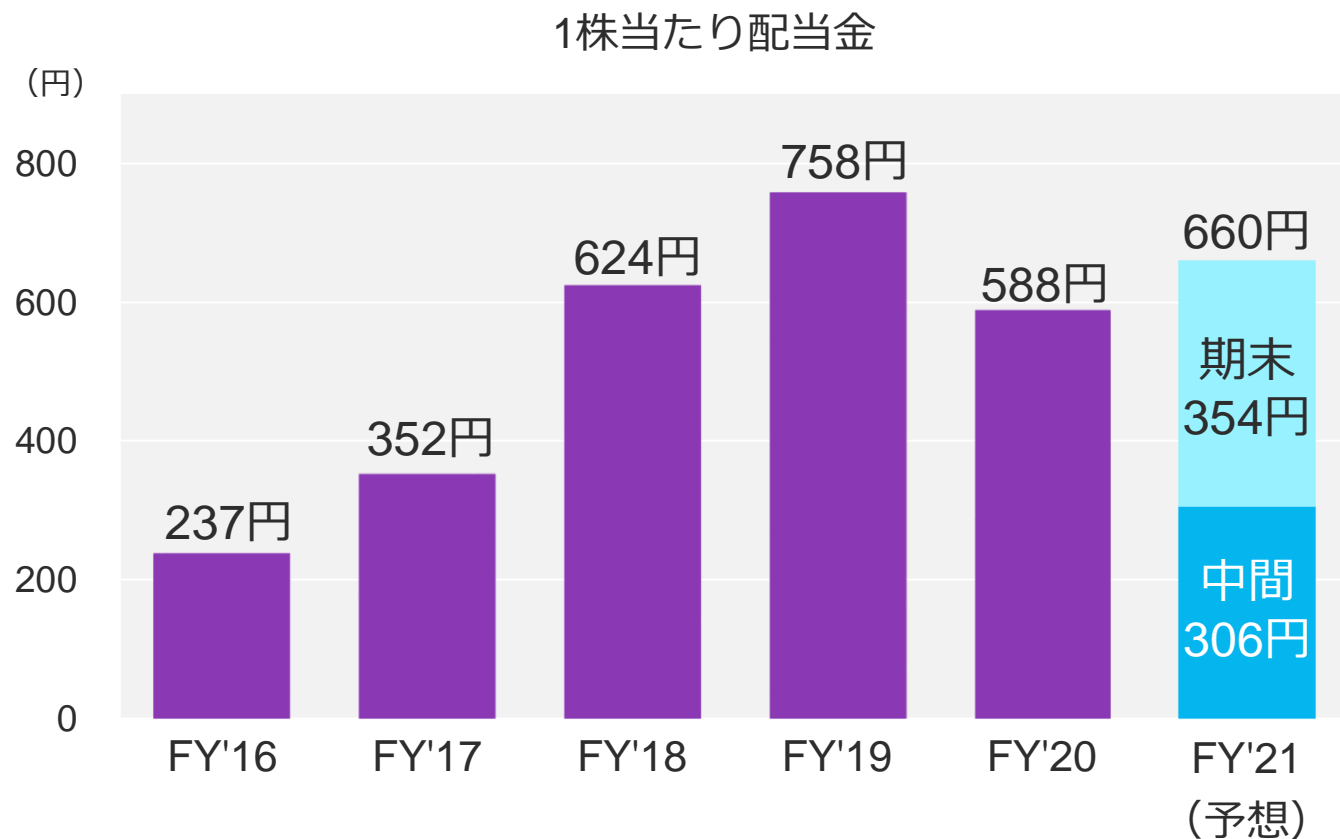
山梨県韮崎市：建設費約130億円
(2020年8月 稼動開始予定)



岩手県奥州市：建設費約130億円
(2020年7月 稼動開始予定)

将来の成長ポテンシャルを最大限取り込むため、
過去最高の研究開発投資を見込む

FY2021 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、配当性向 50%に沿って 660円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON